## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-164614

(43)Date of publication of application: 07.06.2002

(51)Int.CI.

H01S 5/065 H01S 5/022

H01S 5/10

(21)Application number: 2000-361859

(71)Applicant:

NEC CORP

(22)Date of filing:

28.11.2000

(72)Inventor:

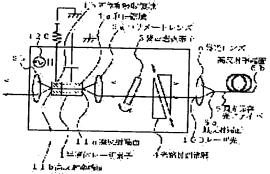
YOKOYAMA HIROYUKI

# (54) EXTERNAL RESONATOR TYPE MODE SYNCHRONIZATION SEMICONDUCTOR LASER SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small-sized external resonator type mode synchronization semiconductor laser system wherein oscillation wavelength is changeable, repetition frequency is at most 1 GHz and changeable, stable operation for a long time is possible, and expedient application to optical measurement is realized.

SOLUTION: In this laser system, a resonator is constituted of a semiconductor laser element and a polarization preservation optical fiber which is coupled optically with the laser element and installed to be exchangeable, and a wavelength selecting element and an optical path length adjusting device are installed in the resonator. The fiber length is so set that the repetition frequency is at most 1 GHz. All components are accommodated in a case and the temperature is controlled.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

12.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-164614 (P2002-164614A)

(43)公開日 平成14年6月7日(2002.6.7)

識別記号

FI

テーマコート\*(参考)

H 0 1 S 5/065

5/022

H 0 1 S 5/065 5/022

5 F O 7 3

5/10

5/10

### 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願2000-361859(P2000-361859)

平成12年11月28日(2000, 11, 28)

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 横山 弘之

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100082935

弁理士 京本 直樹 (外2名)

Fターム(参考) 5F073 AA66 AA74 AA83 AA89 AB25

AB27 AB28 CA07 EA15 FA07

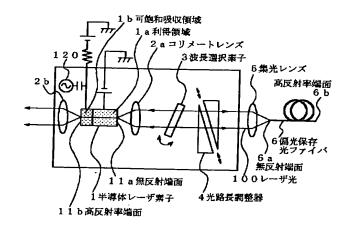
FA25 FA30 GA38

### (54) 【発明の名称】 外部共振器型モード同期半導体レーザ装置

#### (57)【要約】

【課題】発振波長可変、繰り返し周波数1GHz以下且 つ可変で、長時間安定に動作し、光計測に適した小形の 外部共振器型モード同期半導体レーザ装置を提供する。

【解決手段】半導体レーザ素子と、半導体レーザ素子に 光結合し、交換可能に設けた偏光保存光ファイバとで共 振器を構成し、共振器内に波長選択素子と光路長調整器 を備え、1GHz以下の繰り返し周波数になるようファ イバ長を設定して全ての部品を筐体内に収納し、温度制 御している。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザ素子と、前記半導体レーザ 素子に光学的に結合し、着脱自在に設けた偏光保存光フ ァイバとで共振器を構成し、前記共振器内に波長選択素 子と光路長調整器とを備え、モード同期発振周波数が 1 GHz以下となるように前記偏光保存光ファイバの長さ が設定されていることを特徴とする外部共振器型モード 同期半導体レーザ装置。

【請求項2】 半導体レーザ素子と、一方の端面を前記 半導体レーザ素子の一方の端面に光学的に結合し、他方 の端面を前記半導体レーザ素子の他方の端面に光学的に 結合して着脱自在に設けた偏光保存光ファイバとでリン グ共振器を構成し、前記リング共振器内に波長選択素子 と光路長調整器と前記リング共振器から出力光を取り出 す手段とを備え、モード同期発振周波数が1GHz以下 となるように前記偏光保存光ファイバの長さが設定され ていることを特徴とする外部共振器型モード同期半導体 レーザ装置。

【請求項3】 半導体レーザ素子と偏光保存光ファイバ とを1つの筐体に収納したことを特徴とする請求項1又 は2記載の外部共振器型モード同期半導体レーザ装置。

【請求項4】 半導体レーザ素子と偏光保存光ファイバ とを別々の筺体に収納し、半導体レーザ素子を収納した 筐体と偏光保存光ファイバを収納した筐体を上下に着脱 自在に結合したことを特徴とする請求項1又は2記載の 外部共振器型モード同期半導体レーザ装置。

【請求項5】 半導体レーザ素子と偏光保存光ファイバ とを別々の筐体に収納し、半導体レーザ素子を収納した 筐体と偏光保存光ファイバを収納した筐体を互いに側面 で着脱自在に結合したことを特徴とする請求項1又は2 記載の外部共振器型モード同期半導体レーザ装置。

【請求項6】 半導体レーザ素子は、電流注入により発 光・光増幅する利得領域と、入射光強度の増加に伴い光 吸収が減少する可飽和吸収領域とを有することを特徴と する請求項1~5の何れかに記載の外部共振器型モード 同期半導体レーザ装置。

【請求項7】 モード同期用の高周波電圧を半導体レー ザ素子に印加する手段を有することを特徴とする請求項 1~6の何れかに記載の外部共振器型モード同期半導体 レーザ装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、モード同期半導体 レーザ装置に係り、特に、超高速の光信号波形計測等、 光計測技術において利用される超短光パルス発生光源に 適した外部共振器型のモード同期半導体レーザ装置に関 する。

#### [0002]

【従来の技術】最近、光技術の進歩により、フェムト秒 オーダーの超短光パルスの発生が可能になったことか

ら、従来のサンプリングオシロスコープ等の電気的手法 に換えて、超短光パルスをサンプリングゲートパルスと して超高速現象を測定する試みがなされている。

2

【0003】超短光パルスをサンプリングゲートパルス に用いた光サンプリング波形計測、例えば、光波形のア イパターン測定などの光計測においては、個々のサンプ リング値を測定するために、個々の相互相関信号光パル スを隣接パルスとの干渉なしに光電変換する必要があ る。そのため、相互相関信号光パルスの繰り返し周波 数、即ち、サンプリング光パルスの繰り返し周波数を受 光系の帯域以下に設定する必要上、光通信の場合と異な り、1GHz以下の低い繰り返し周波数の光パルス列が 要求される。また、分解能の向上を図るために数ピコ秒 ~数フェムト秒の超短光パルスが求められている。この ような繰り返し周波数が低い超短光パルス列を発生する 手段の1つとして、図8に示す外部共振器を用いたモー ド同期半導体レーザ装置がある。

【0004】図8の外部共振器型モード同期半導体レー ザ装置は、可飽和吸収領域1b並びに利得領域1aを有 20 する半導体レーザ素子1と、この半導体レーザ素子1の 可飽和吸収領域側端面11bとの間で外部共振器を構成 する反射鏡8と、これら半導体レーザ素子1と反射鏡8と の間に設けられ、両者を光学的に結合するためのコリメ ートレンズ2aと、このコリメートレンズ2aと反射鏡 8との間に設けられた波長選択素子3及び折り返し反射 鏡7とを有し、可飽和吸収領域側端面111からコリメ ートレンズ2bを介して光出力を取り出す構成である。 レーザ発振波長は、外部共振器の内部に設けられている 波長選択素子3の、外部共振器の光学軸とのなす角度を 30 調節することにより任意の波長に設定する。

【0005】折り返し反射鏡7は、モード同期半導体レ ーザ装置の小型化のために設けたのであって、無くても よい。この折り返し反射鏡7は、半導体レーザ素子1の 可飽和吸収領域16の端面116と反射鏡8とで構成す る外部共振器の共振器長を可変できるように半導体レー ザ素子1の光学軸に沿って矢印Aの如く移動可能に構成 されている。折り返し反射鏡7を移動することで共振器 長を可変し、光パルスが共振器を往復する周期(繰り返 し発振周波数)を変化させることができる。

#### [0006] 40

【発明が解決しようとする課題】光計測においては、発 振波長、繰り返し周波数、偏光状態、光出力強度等の高 度の安定性が要求される。例えば、偏波面の状態を被測 定回路の動作電圧に応じて変化させて偏波面の変化を検 出する場合、偏波面が変動すると正確な測定ができなく なるので、偏波面が一定に保たれている必要がある。ま た、時系列に沿ったサンプリングを行うためには、繰り 返し周波数が安定しているサンプリングパルスが必要と なる。例えば、1GHzの繰り返し周波数で、その揺ら 50 ぎを数十Hzオーダー以下とする場合、10<sup>-7</sup>~10<sup>-8</sup>

のオーダーの周波数安定度が必要である。さらに、被測 定光(被測定信号)の繰り返し周波数の揺動に対してサ ンプリング光の繰り返し周波数を追従させることも必要 である。しかし、図8に示した従来の外部共振器型モー ド同期半導体レーザ装置ではこれらの対策が不十分で、 温度変化に伴う共振器長変化でモード同期周波数が目的 とする周波数から許容範囲を超えて大きく変化する。

【0007】1GHz以下の繰り返し周波数(モード同 期発振周波数)を有するモード同期半導体レーザ装置で は、十数cm~数十cmの外部共振器が必要である。図 8に示す外部共振器構成のモード同期半導体レーザ装置 では、自由空間の光路を用いているために共振器長が長 く、例えば、繰り返し周波数が1GHzの場合、共振器 長は15cm、250MHzの場合は60cmにもな り、光路を狭い空間に納めるのが難しく、小形化が難し く、サイズの大きな筺体が必要になる。この結果、僅か の振動や歪みでも部品の位置が大きく変位し、温度変化 や機械的振動の影響を受けやすく、発振波長、繰り返し 周波数、偏光状態、光出力強度等が許容範囲を超えて変 動して、長時間の高安定動作が難しい。さらに、共振器 20 長が長いのに加えて、折り返し反射鏡7を有しているた め、共振器の光軸調整等の光学整合や取り扱いが煩雑で 困難であると共に、外部共振器型モード同期半導体レー ザ装置を計測装置に組み込む場合、計測装置全体のサイ ズを大きくすることにもなる。

【0008】本発明は、外部共振器型モード同期半導体 レーザの小形化を図り、温度変化や機械的振動に強く、 発振波長、繰り返し周波数、偏波面等の安定性に優れ、 長時間安定に動作し、且つ、発振波長可変、繰り返し周 波数可変の、光計測に適した外部共振器型モード同期半 導体レーザ装置を提供することを目的としている。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体レーザ 素子と、前記半導体レーザ素子に光結合し、着脱自在に 設けた偏光保存光ファイバとで共振器を構成し、共振器 内に波長選択素子と光路長調整器とを備え、モード同期 発振周波数が1GHz以下となるように偏光保存光ファ イバの長さが設定されていることを特徴とする外部共振 器型モード同期半導体レーザ装置である。

【0010】本発明のもう1つの外部共振器型モード同 期半導体レーザ装置は、半導体レーザ素子と、一方の端 面を前記半導体レーザ素子の一方の端面に光結合し、他 方の端面を前記半導体レーザ素子の他方の端面に光結合 して着脱自在に設けた偏光保存光ファイバとでリング共 振器を構成し、前記リング共振器内に波長選択素子と光 路長調整器と前記リング共振器から出力光を取り出す手 段とを備え、モード同期発振周波数が1GHz以下とな るように前記偏光保存光ファイバの長さが設定されてい ることを特徴とする構成である。

装置の何れも、半導体レーザ素子と偏光保存光ファイバ とを同一の筐体に収納しているが、半導体レーザ素子と 偏光保存光ファイバとを別々の筐体に収納し、これら2 つの筺体を互いに着脱自在に結合した構成とすると、結 合した筺体の何れか一方を交換することで、発振波長や モード同期発振周波数(繰り返し周波数)を容易に変更 できる。2つの筺体を結合する構造は、半導体レーザ素 子を収納した筺体と偏光保存光ファイバを収納した筺体 を上下に着脱自在に結合する構造、或いは、2つの筐体 10 を互いに側面で着脱自在に結合した構造の何れでもよ い。半導体レーザ素子と偏光保存光ファイバとを別々の 筐体に収納した構成は、半導体レーザ素子と偏光保存光 ファイバとを独立に温度調整でき、温度制御の精度が向 上し、安定性のよい外部共振器型モード同期半導体レー ザ装置が得られる。

【0012】さらに、本発明の外部共振器型モード同期 半導体レーザ装置に用いる半導体レーザ素子を、電流注 入により発光・光増幅する利得領域に加え、入射光強度 の増加に伴い光吸収が減少する可飽和吸収領域を有する 構成にすると、パルス幅の狭い光パルスが得られる。

【0013】本発明の外部共振器型モード同期半導体レ ーザ装置においては、モード同期用の髙周波電圧印加手 段と発光・光増幅のための電流注入手段により、半導体 レーザ素子1にモード同期周波数の高周波電圧印加と発 光・光増幅のための電流注入が行われ、モード同期レー ザ発振する。

#### [0014]

【発明の実施の形態】本発明の外部共振器型モード同期 半導体レーザ装置は、図1に示すように、半導体レーザ 30 素子1と、コリメートレンズ2a、2bと、波長選択素 子3と、光路長調整器4と、集光レンズ5と、光学部品 (コリメートレンズ、波長選択素子、光路長調整器、集 光レンズ等を総称して光学部品と記す) を介して半導体 レーザ素子1に光学的に結合された偏光保存光ファイバ 6とを有し、半導体レーザ素子端面11bと偏光保存光 ファイバの端面(高反射率端面))6bとで共振器を構 成している。半導体レーザ素子1には発光・光増幅のた めの電流注入と高周波電源120によるモード同期周波 数の高周波電圧印加とが行われる。

【0015】電流注入とモード同期周波数の高周波電圧 印加により半導体レーザ素子1で発生したレーザ光10 Oは、共振器端面6b、11bで反射し、周期T (T= 2 L/c、Lは真空長換算の共振器長、cは光速)で共 振器内を繰り返し往復することで光増幅され、その周期 Tに同期した繰り返し周波数 (モード同期周波数) f (f = c / 2 L) でレーザ発振し、一部が共振器端面 (本実施形態では半導体レーザ素子端面11b) を透過 して出力される。

【0016】半導体レーザ素子1はどの様な構造のもの 【0011】上記外部共振器型モード同期半導体レーザ 50 でもよい。本実施形態の半導体レーザ素子1は、電流注

る。また、2枚の平面鏡の間に液晶を挟んでエタロンを 構成した場合、液晶に電圧を印加することにより、液晶 の屈折率を変えることができるので、印加電圧を制御す

6

入により発光・光増幅に与る利得領域1aと、光強度の 増加に伴い光吸収が減少する可飽和吸収領域 1 b とを有 し、利得領域 1 a の活性層と可飽和吸収領域 1 b の可飽 和吸収層はバンドギャップ波長が1.55μ m組成のⅠ nGaAs/InGaAsP多重量子井戸構造(バルク の活性層、可飽和吸収層でもよい)で構成し、ストライ プ状の活性層並びに可飽和吸収層の両側に電流ブロック 層が設けられた埋め込み構造になっている。利得領域1 a 及び可飽和吸収領域 l b の各端面 l l a 、 l l bには 誘電体多層膜、例えば、TiO2/SiO2多層膜或いは Si/SiO2多層膜がコーティングされて、可飽和吸 収領域側の端面11bが高反射率面、利得領域側の端面 11aが低反射率面(無反射端面)になっている。高反 射率面の反射率R1はR1≒0.8程度、低反射率面の 反射率R2はR2≤10<sup>-4</sup>程度に設定されている。利得 領域1aと可飽和吸収領域1bには相互に独立に電力の 供給が可能に電極(図示省略)が設けられて、これら電 極を介して利得領域1aに直流電流が、可飽和吸収領域 1 b に逆バイアス電圧及びモード同期周波数のモード同 期用高周波信号が供給される。可飽和吸収領域1bに電 力を供給せずに、利得領域1aのみにモード同期周波数 で変調した電流を注入する構成にしてもよい。また、可 飽和吸収領域を設けずに、利得領域のみから成る半導体 レーザ素子を用いた場合は、利得領域に注入する電流に 重畳して髙周波信号を印加する構成となる。

【0017】可飽和吸収領域1bは、光パルスが入射されるとその前半部(低光強度の部分)は吸収し、光パルスのピーク近傍(高光強度の部分)では吸収が飽和するためそのまま通過させる。この結果通過する光パルスの急峻化が行われ、光パルスが可飽和吸収領域1bを通過するたびに急峻化されて狭い光パルスを得ることができる。また、可飽和吸収領域1bの自己吸収変調効果によりレーザ発振縦モード間の位相が同期する。この可飽和吸収領域1bに高周波信号を供給すると、モード同期による光パルス発生タイミングが供給された高周波信号に同期する。

【0018】波長選択素子3は、一例としてファブリー・ペロエタロン(以下、エタロンと記す)で構成されている。図1に示すように、エタロンは石英やガラスの平行平面板の両面に誘電体多層膜或いは金属膜を形成して互いに対向する2つの面の反射率を高めた構成になっていて、所定間隔で平行に対向配置された2つの反射面の反射率と間隔により決定される波長間隔で透過率が最大となる。このエタロンを光軸に対して傾けることによって透過率が最大となる波長を制御して、レーザ光の波長を任意の波長に設定する。

【0019】上記の構成に替えて、2枚の平面鏡を、圧電素子を間に挟んで貼り合わせてエタロンを構成とすると、圧電素子に電圧を印加することで平面鏡間の距離を変化できるので、透過率が最大となる波長を制御でき

の屈折率を変えることができるので、日が地上を開始することで透過率が最大となる波長を制御できる。 【0020】光路長調整器4は、光ファイバ長さの誤差を補償するために設けたもので、図1、図2(a)に示す如く、石英やガラス等の透明な材質から成る2つの楔形のプリズム21、22で構成されている。これら2つの楔形プリズム21、22は屈折率が等しく、同じ頂角を有し、傾斜面21a、22a同士を互いに対向或いは接触させ、垂直面21b、22bを光軸20に対して直

角に配置され、矢印方向に移動可能になっている。楔形 プリズム21、22の移動により、レーザ光が通過する 部分の厚さd1、d2が変化して、その部分の光路長が 変化する。この結果、光ファイバ長さの誤差を光路長調 整器4で補償することができる。

【0021】図2 (b) に、もう1つの光路長調整器4 の例を示す。この光路長調整器4は、2つの二等辺直角 プリズム23、24から成り、これら2つの二等辺直角 20 プリズム23、24は、それぞれ、直角に組み合わされ た反射面23a、23b、24a、24bを有してい る。これら2つの二等辺直角プリズムの内の一方の二等 辺直角プリズム (第1二等辺直角プリズム) 23は、斜 辺(底辺)23cを光軸20に平行にして光軸上に固定 されている。もう一方の二等辺直角プリズム(第2二等 辺直角プリズム)24は、その底辺24cが光軸上に固 定された第1二等辺直角プリズム23の頂角Aに対向 し、且つ、第1二等辺直角プリズム33の底辺23cに 平行に配置され、矢印の方向に移動可能、即ち、光軸2 30 0に直交する方向に移動可能になっている。第2二等辺 直角プリズム24が矢印方向に移動することで、2つの 二等辺直角プリズム間の距離が調整され、光路長が調整 される。第2二等辺直角プリズム24の変位δに対して 光路長は2δ変化する。この光路調整器に入射したレー ザ光100は、図に示す如く、反射面23a、24a、 24b、23bを経由して偏光保存光ファイバ6に出射 する。

【0022】光導波路を形成する偏光保存光ファイバ6は、一方の端面が誘電体多層膜や金属膜が被着された高 の 反射率端面 6 b で、他方の端面 6 a が誘電体多層膜から 成る無反射コーティング (反射防止膜) が施されている。反射防止膜が施された端面 (無反射端面) 6 a は光学部品 (コリメートレンズ、液長選択素子、光路長調整器、集光レンズを総称して光学部品と記す) を介して光学部品と記す) を介して光学部品と記す) を介して光学の低反射率端面 (利得領域側の端半導体レーザ素子1の高反射率端面 (可飽和吸収領域側の端面) 11 b とでファブリー・ペロ型の共振器を構成している。かかる構成において、半導体レーザ素子1の高反射率端面 (列率端面11 b と偏光保存光ファイバ6の高反射率端面

6 b との距離が共振器長となり、モード同期発振の繰り返し周波数が1GHz以下になるようにファイバ長が設定されている。例えば、繰り返し周波数が1GHzの場合は15cm、500MHzの場合は30cm、250MHzの場合は60cmにファイバ長が設定され、さらに低い繰り返し周波数が必要な場合は、さらに長い偏光保存光ファイバを用いる構成になる。

【0023】偏光保存光ファイバ6は、図3に示すように、リング状に巻かれて半導体レーザ素子1等その他の光学部品と共に1つの筐体17に収められ、コンパクトな構成の外部共振器型モード同期半導体レーザ装置を構成している。このように、偏光保存光ファイバをリンケ状に巻いて半導体レーザ素子等その他の部品と共に欠めると従来よりもコンパクトになり、空間的とないで、温度調節しなくてもよいが、本実施形態では室内に温度制御素子を具備して温度調節し、安定性をさらに高めている。なお、図3(a)は筐体の蓋を開けた状態の平面図、(b)は(a)のA-A、線に沿う断面図である。

【0024】大きさが数cm×数cm、厚さ数mmの熱 伝導率のよい、例えば、窒化アルミニウム (AlN)等 のセラミック基板14(あるいは金属基板)が筺体内に 設置・固定され、セラミック基板14上に、例えば、シ リコンや銅タングステン (CuW)、ステンレス等で成 る基板13と偏光保存光ファイバ6が載置・固定されて いる。CuW基板13上には、半導体レーザ素子1、コ リメートレンズ2a、2b、波長選択素子3、光路長調 整器4、集光レンズ5が互いに光軸を一致させて搭載・ 固定されている。半導体レーザ素子1はヒートシンク1 2を介してCuW基板上に固定されている。 偏光保存光 ファイバ6は無反射コーティングが施された先端部が光 コネクタ16aを介してCuW基板13に着脱自在に装 着されて、光学部品を介して半導体レーザ素子1と光学 的に結合されている。残余の部分はリング状に巻かれて セラミック基板14に固定部材(図示省略)により着脱 可能に固定されている。セラミック基板14は温度制御 素子15、例えばペルチエ素子上に載置されて、半導体 レーザ素子1をはじめとする各部品の温度およびその周 囲の筐体内の温度、即ち、共振器の温度が一定になるよ うコントロールされ、共振器長、発光強度、発振波長等 の安定化が図られている。モード同期光出力は半導体レ 一ザ素子1の可飽和吸収領域1bの高反射率端面11b (図1参照)から取り出す構成で、半導体レーザ素子1 の出力面側(高反射率端面側)の筐体側面には、外部フ ァイバと接続して出力光パルス列を取り出せるように、 光コネクタ16bが設けられている。光コネクタ16b と半導体レーザ素子1との間に光アイソレータ (図示省 略)、コリメートレンズ2bが設けられている。かかる

ード同期発振させるには、光路長が60cmの共振器長が必要となるが、偏光保存光ファイバ6をリング状に巻いてセラミック基板14に固定しているので、筐体17の大きさが最長で10cm程度となりコンパクトな構成になっている。また、偏光保存光ファイバ6が光コネクタ16aを介して着脱自在に取り付けられているので、長さの違う偏光保存光ファイバに容易に交換でき、繰り返し周波数の変更が容易に行える。

8

【0025】偏光保存光ファイバ6の無反射コーティングが施された先端部を、光コネクタ16aを介してCuW基板13に着脱自在に装着した構成に替えて、保持部材で無反射コーティングが施された先端部を挟んで偏光保存光ファイバ先端部をCuW基板13に着脱自在に固定しても良い。この場合、CuW基板13や保持部材にV溝を設けると偏光保存光ファイバの位置決めが容易となる。また、保持部材はネジ等でCuW基板13やセラミック基板14に固定する構成とすればよい。

【0026】図4に本発明の第2の実施の形態を示す。 この実施形態の外部共振器型モード同期半導体レーザ装 20 置は、半導体レーザ素子1と偏光保存光ファイバ6を別 々の筐体17a、17bに収納した例である。

【0027】図4(a)(筐体側面を一部切り欠いた側 面図)の外部共振器型モード同期半導体レーザ装置は、 半導体レーザ素子1と結合光学系110 (コリメートレ ンズ2a、波長選択素子3、光路長調整器4、集光レン ズ5で構成された部分)とをシリコン基板13aを介し て温度制御素子15 (ペルチエ素子) 上に載置・固定し て1つの筐体17a (第1の筐体) に収納し、偏光保存 光ファイバ6をリング状に巻いてセラミック基板14を 介して温度制御素子15 (ペルチエ素子) 上に載置・固 定して別の筐体17b (第2の筐体) に収納して、これ ら2つの筐体17a、17bを着脱可能に重ね合わせ、 固定した重箱構造である。第1の筐体17aの上面と第 2の筐体17bの底面にはそれぞれ光コネクタ18a、 18 b が設けられており、筐体17 a、17 b を重ね合 わせて結合した際にこれら光コネクタ18a、18bが 嵌合し、偏光保存光ファイバ6と半導体レーザ素子1が 光学的に結合する。半導体レーザ素子1と光コネクタ1 8aとの光学的結合には、一端が保持部材190でシリ コン基板13aに固定され、他端が光コネクタに接続し ている接続用の短い偏光保存光ファイバ19を用いてい る。また、図4 (b) に示すように、筐体側面にそれぞ れ光コネクタ18a、18bを設け、筐体17a、17 b を重ね合わせて結合した際にそれら光コネクタ18 a、18bを接続用の短い偏光保存光ファイバ19aで 接続した構成としてもよい。

大コネクタ16 b か設けられている。光コネクタ16 b 【0028】図4 (c)の外部共振器型モード同期半導と半導体レーザ素子1との間に光アイソレータ(図示省 体レーザ装置は、2つの筐体17a、1.7 b を筐体側面 で着脱自在に結合した構成である。この場合、接合面と構成によれば、例えば繰り返し周波数250MHzでモ 50 なる側面にそれぞれ光コネクタ18a、18 b を設け、

**筺体17a、17bを結合したときに光コネクタ同士が** 嵌合し、偏光保存光ファイバ6と半導体レーザ素子1が 光学的に結合する構成になっている。なお、上記

(a)、(b)、(c)何れの場合も2つの筐体間はネジやクランプ等(図示省略)で固定している。

【0029】第2実施形態においては、半導体レーザ素子1や光学部品の配置を考慮することなく偏光保存光ファイバ6を筐体内に収納できるので、繰り返し周波数が低く共振器長が長い場合に特に有効な構成である。また、異なる発振波長の半導体レーザ素子1を収納した筐体17aやファイバ長の異なる偏光保存光ファイバ6が収納された筐体17bを多数用意すれば、筐体を取り替えるだけで繰り返し周波数や発振波長を容易に変更できる。

【0030】上記何れの実施形態においても、出力光は 半導体レーザ素子端面から取り出したが、偏光保存光ファイバ端面(高反射率端面6b)から光出力を取り出す 構成としてもよい。この場合、半導体レーザ素子1を収納した筐体17aにではなく、偏光保存光ファイバ6を 収納した筐体17bに出力用の光コネクタを設け、偏光 保存光ファイバ6の高反射率端面6bを筐体17bに設けた出力用の光コネクタに接続した構成にすればよい。 半導体レーザ素子1の高反射率端面側に設けたコリメートレンズ2b(図1参照)は不要となる。

【0031】図5に本発明の第3の実施の形態を示す。 この外部共振器型モード同期半導体レーザ装置は、リン グ共振器構造とした例である。

【0032】本実施形態の外部共振器型モード同期半導 体レーザ装置は、図5に示すように、両端面に誘電体多 層膜 (例えば、TiO2/SiO2) による無反射コーテ ィングを施した半導体レーザ素子1と、コリメートレン ズ2a、2bと、波長選択素子3と、光路長調整器4 と、集光レンズ5a、5bと、偏光保存光ファイバ6 と、光アイソレータ9とを有し、これら部品が、第1実 施形態と同様にして、基板上(図示省略、必要なら図3 参照) に載置・固定され、温度制御素子(図示省略、必 要なら図3参照)と共に筐体内(図示省略、必要なら図 3参照) に収納されて温度制御されたコンパクトな構成 になっている。偏光保存光ファイバ6は、繰り返し発振 周波数が1GHz以下になる長さに設定され、その両端 面は、半導体レーザ素子1と同様、無反射コーティング が施され、その一方の端面がコリメートレンズ2a、波 長選択素子3、光路長調整器4、集光レンズ5aを介し て半導体レーザ素子1に光学的に結合され、他方の端面 がコリメートレンズ2b、集光レンズ5bを介して半導 体レーザ素子1に結合されてリング共振器を構成してい る。リング共振器中には光アイソレータ9が設けられ

(共振器中の設置位置はどこでもよい)、時計回り進行 子、分布ブラッグ反射型(DBR)半導体レーザ素子 波、反時計回り進行波の共振モードの内の何れか一方の 変調器を集積化した半導体レーザ素子(変調器にモー 進行波共振モード(本実施形態は時計回りの進行波共振 50 同期周波数の高周波電圧を印加する)等を用いてもよ

モードを選択)のみが発振するようになっている。光パルスを外部に取り出す手段は偏光保存光ファイバ6の中程に取り出し用光ファイバ60を接触させて設けた方向性光結合器10を用いている。また、方向性光結合器10に替えてY分岐からなる光分波器を用いて光パルスを外部に取り出す構成、或いは、リング共振器中に半透明鏡を設けてこの半透明鏡から取り出す構成としてもよ

い。なお、本実施形態では光アイソレータ9を共振器中

10

に設けたが、この光アイソレータ9を設けない構成とし 0 てもよい。

【0033】半導体レーザ素子1は、第1実施形態と同様のものでもよいが、本実施形態においては、図6に示すように、2つの利得領域1aとその間に挟まれた可飽和吸収領域1bを有するものを用いている。可飽和吸収領域1bには、第1実施形態と同様、逆バイアスと高周波電圧(周回するレーザ光に同期した変調信号)が印加され、利得領域1aには直流電流が注入される。

【0034】利得領域1aへの電流注入によって発生した光は、可飽和吸収領域1bで変調された光となって出力され、光学部品、偏光保存光ファイバ6等で構成されたリング共振器を周回する。周回した光が半導体レーザ素子1に入射した際に、可飽和吸収領域1bに印加した高周波信号により、その光がリング共振器を一周する時間またはその整数分の一の周期で変調を受けて周回周期に同期した繰り返し周波数の短光パルスに成長する。この短光パルスが方向性光結合器10で取り出し用偏光保存光ファイバ60から出力光パルス列となって出力される。

【0035】上記の構成に替えて、第2実施形態(図4)のように、半導体レーザ素子1と偏光保存光ファイバ6とを別々の筐体17a、17bに収納し、これら2つの筐体17a、17bを着脱自在に接合した構成としてもよい。この場合、図7に示すように、半導体レーザ素子1と偏光保存光ファイバと6を光学的に結合するための光コネクタ18a、18bが第2実施形態の場合よりも1つずつ加え、偏光保存光ファイバを収納した筐体17bに光出力用の光コネクタ16bを設けた構成になる。なお、図7の例は、2つの筐体17a、17bを上下に重ね合わせる構成であるが、この構成に替えて、図4(c)のように、2つの筐体を側面で着脱可能に接続する構成としてもよい。

【0036】上記何れの実施の形態も、可飽和吸収領域を有する半導体レーザ素子を用いたが、可飽和吸収領域のない利得領域のみの半導体レーザ素子でもよい。この場合は利得領域に注入する電流にモード同期周波数の電流を重畳すればよい。さらに、実施形態の半導体レーザ素子に替えて、分布帰還型(DFB)半導体レーザ素子、分布ブラッグ反射型(DBR)半導体レーザ素子、変調器を集積化した半導体レーザ素子(変調器にモード同期周波数の高周波電圧を印加する)等を用いてもよ

い。なお、DFB半導体レーザ素子やDBR半導体レーザ素子を用いた場合は、波長選択案子は不要となる。

#### [0037]

【発明の効果】本発明は、外部共振器を構成する光導波路に偏光保存光ファイバを用いているので偏光状態が一定に保たれる。また、長尺の偏光保存光ファイバをリング状に巻いて半導体レーザ素子等その他の部品と共に宣体に収め、温度調節しているので、筐体は大きくても20cm程度となり、共振器長が長くてもコンパクトになる。このように、従来のものよりも狭い空間に全てのお品が納められているので、空間的な温度分布揺らぎる。このように、近来のものよりも狭い空間に全ての影響が小さいのに加え、温度制御する空間が狭いので、精密な温度調節ができる。この結果、温度制御の精度が向上し、レーザ発振波長、繰り返し周波数、偏光状態、発光強度等の特性が機械的振動や周囲の温度変動、部品を設置した基板の歪みに対して安定で、信頼性が向上する。

【0038】また、従来は、外部共振器の光導波路に自由空間の長い光路を利用しているため、僅かの振動や歪みでも共振器の反射鏡位置が大きく変位し、光軸がずれ 20 て特性が変動するが、本発明は、光導波路に光ファイバを用いているため、共振器の反射面となる光ファイバ端面位置が変動しても、光ファイバを伝搬する光は確実にファイバ端面に達するから、従来と異なり、振動や、基板の歪みに対しても安定な特性が得られる。

【0039】さらに、本発明は、波長選択素子と光路長調整器とを備え、且つ、光ファイバが交換可能な構造になっているので、発振波長や繰り返し周波数の微調整ができると共に、種々のファイバ長の光ファイバと発振波長の異なる種々の半導体レーザ素子の組み合わせが自在30にでき、繰り返し周波数の変更や発振波長の変更が容易に行える。

【0040】特に、半導体レーザ素子と光ファイバとを別々の筐体に収納した構造では、それぞれの筐体毎に独立に温度制御できるので、さらに精密な温度管理が実現でき、より安定な装置が得られる。また、光コネクタは嵌合するだけで接続でき、ネジやクランプ等で筐体が固定できて筐体の着脱も容易であるので、1つの筐体に全ての部品を収納した場合よりも容易に繰り返し周波数や発振波長を容易に変更できる。

【0041】以上のように、本発明は共振器長が長く、小型、且つ、高安定な外部共振器型モード同期半導体レーザ装置を得ることができる。また、偏光保存光ファイバを用いて共振器長が長い共振器を構成し、1GHz以下の低い繰り返し周波数を実現しているので光計測に適している。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の外部共振器型モード同期半導体レーザ装置の概略構成図。

【図2】 光路長調整器の概略図。

【図3】 第1の実施の形態を示す図。(a)は平面図、(b)は(a)のAA、線に沿った断面図。

【図4】 第2の実施の形態を示す側面図。

【図5】 第3の実施の形態を示す概略図。

【図6】 第3の実施の形態で用いた半導体レーザ素 子の概略側面図。

【図7】 第3の実施の形態の側面図。

【図8】 従来の外部共振器型モード同期半導体レーザ装置の概略構成図。

#### 10 【符号の説明】

1 半導体レーザ素子

1 a 利得領域

1 b 可飽和吸収領域

2a コリメートレンズ

2 b コリメートレンズ

3 波長選択素子

4 光路長調整器

5 集光レンズ

5 a 集光レンズ

20 5 b 集光レンズ

6 偏光保存光ファイバ

6 a 無反射端面

6 b 高反射率端面(共振器端面、ファイバ端面)

7 折り返し反射鏡

8 反射鏡

9 光アイソレータ

10 方向性光結合器

11a 無反射端面

11b 高反射率端面

30 12 ヒートシンク

13 CuW基板

14 セラミック基板

15 温度制御素子

16a 光コネクタ

16 b 光コネクタ

17 筐体

17a 筐体

17b 筐体

18a 光コネクタ

40 18 と 光コネクタ

19 接続用光ファイバ

19a 接続用光ファイバ

20 光軸

21 楔形プリズム

21a 傾斜面

2 1 b 垂直面

22 楔形プリズム

22a 傾斜面

22b 垂直面

50 23 二等辺直角プリズム

13

 23 a
 反射面

 23 b
 反射面

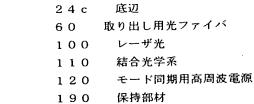
 23 c
 底辺

24 二等辺直角プリズム

 24a
 反射面

 24b
 反射面

【図1】

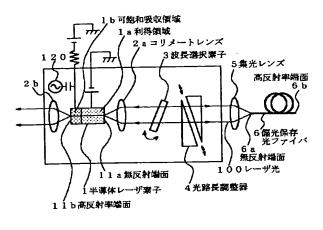


【図2】

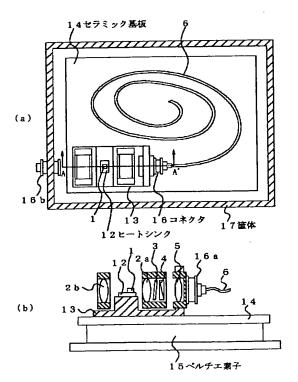
【図6】

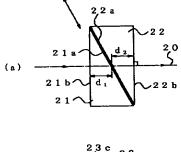
1 a 利得領域 可飽和吸収領域

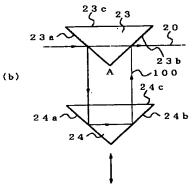
la 利得領域



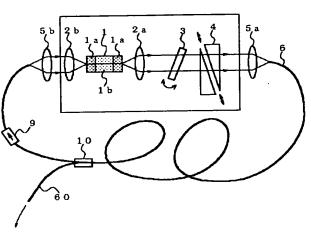
【図3】



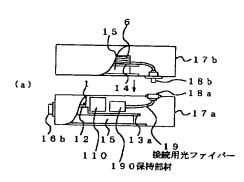


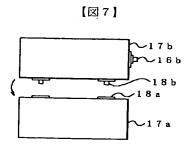


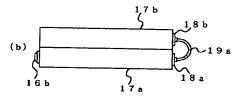
【図5】

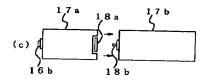


【図4】









【図8】

